

第40回熊谷記念真空科学論文賞，第40回真空技術賞， 第24回真空進歩賞，第4回真空会誌賞

候補業績募集要項

一般社団法人日本真空学会

本賞は真空科学，真空技術およびその関連分野など（たとえば，表面・薄膜などの分野も含む）の発展に寄与するために，この分野で公表された顕著な業績を「表彰規程」（下記）にしたがって表彰するもので，第6回真空科学国際会議開催を記念する基金，熊谷記念基金及び寄付金をもって運用されています。なお，表彰対象となる論文は本誌掲載のものに限りますのでご注意ください。（受賞対象に関しましては，過去10年間の表彰業績一覧をご参照ください。）

論文賞・技術賞・進歩賞・会誌賞候補に推薦され，また応募された業績に対して審査を行いますので，自薦他薦とも下記要領によりご応募下さい。

1. 提出書類：候補業績名（論文の場合は論文名），公表年月日（論文の場合は「J. Vac. Soc. Jpn.」号，巻，頁）推薦理由または応募理由（400字以内），および推薦者名または応募者名を明記したA4判書きの書類（書式任意）
2. 提出先：一般社団法人日本真空学会事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館306号室 TEL：(03) 3431-4395, E-mail: ofc-vs@vacuum-jp.org
3. 論文等の表彰対象：本誌の Vol. 57, No. 4 から Vol. 58, No. 3（平成26年4月～平成27年3月）に掲載された論文
4. 提出期限：平成27年5月15日（金）（厳守）

以上

表彰規程

第1条 この規定は真空科学および真空技術の向上と発展に寄与した顕著な業績に対して日本真空学会が行なう表彰について定める。

第2条 真空科学に関する表彰を「熊谷記念真空科学論文賞」，真空技術に関する表彰を「真空技術賞」，若手会員の業績を表彰するものを「真空進歩賞」，会員への啓蒙に関する表彰を「真空会誌賞」という。

第3条 この表彰の基金は第6回真空科学国際会議記念基金と寄附金をもって当てる。表彰に要する経費は基金の利息をもって当てることを原則とする。

第4条 表彰への応募資格および被推薦資格は原則として本会会員による業績とする。

第5条 熊谷記念真空科学論文賞の対象は，原則として表彰を行う年の3月までの1年間に発刊された「JOURNAL OF THE VACUUM SOCIETY OF JAPAN」誌に発表された独創的な優秀論文とする。ただし数年にわたって継続発表されたものを含む。

第6条 真空技術賞の対象は，表彰を行う年の3月までに公知となっている優れた製品，開発された新技術および技術論文などとする。ただし，技術論文は原則として表彰を行う年の3月までの1年間に発刊された「JOURNAL OF THE VACUUM SOCIETY OF JAPAN」誌に発表されたものに限る。

第7条 真空進歩賞は真空に関する学理および技術の進歩に貢献する当該年度4月1日現在39歳以下の若手会員の業績を表彰するものとする。

第8条 真空会誌賞の対象は，原則として表彰を行う年の3月までの1年間に発刊された「JOURNAL OF THE VACUUM SOCIETY OF JAPAN」誌に掲載された原著論文以外の記事で，会員にとって啓発的，教育的であり，真空科学および真空技術の進歩向上を促すものとする。ただし数年にわたって継続発表されたものを含む。

第9条 表彰は第5条，第6条，第7条，第8条に該当する業績をあげた個人または団体に対する賞状および副賞記念品贈呈をもって行なう。賞状は共同研究，共同開発の場合には関係者全員に贈り，団体の場合にはその代表者1名に贈る。

第10条 表彰件数は原則として毎年「熊谷記念真空科学論文賞」「真空技術賞」「真空進歩賞」および「真空会誌賞」各1件とし，該当するもの無い場合には取り止め，次年度に繰り越さない。

第11条 表彰は毎年真空に関する連合講演会会期中に会長が行なう。

第12条 受賞候補は会員より推薦された候補から，表彰審査会が選考を行い理事会に提案する。

第13条 理事会は前条により提出された受賞業績候補について，審議のうえ，受賞業績ならびに受賞者を決定する。

第14条 この規程の改廃は理事会の決議による。

附則

1. この規程は昭和51年2月21日より施行する。
2. この規程は平成24年1月18日開催の理事会で改定し，平成24年2月28日より施行する。

過去10年間の表彰業績一覧

第30回熊谷記念真空科学論文賞（平成17年度）

「Si(100)上ゲルマン吸着に伴う水素移動と Ge/Si 原子交換の観察」

村田威史, 末光真希（東北大学学際科学国際高等センター）

第30回真空技術賞（平成17年度）

「ねじれを吸収する溶接偏芯ベローズの開発」

津金洋之, 清水広幸, 三柴 隆（株ミラプロ）
吉岡正人（山梨大学工学部）

第30回真空技術賞（平成17年度）

「アークプラズマガンを用いた新規材料 GeC 薄膜の分子線エピタキシー成長」

布下正宏, 太田 淳（奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科）

沖仲元毅（理化学研究所ナノサイエンス研究技術開発・支援チーム）

第14回真空進歩賞（平成17年度）

該当なし

第31回熊谷記念真空科学論文賞（平成18年度）

該当なし

第31回真空技術賞（平成18年度）

「極高真空用残留ガス分析計の開発」

渡辺文夫（㈱真空実験室）

第15回真空進歩賞（平成18年度）

「高濃度オゾンガス局所リアルタイム濃度測定法の開発」

佐藤陽亮（産業技術総合研究所, 東京理科大学）

第15回真空進歩賞（平成18年度）

「鏡面反射成分を考慮したオリフィス透過確率のモンテカルロシミュレーション」

城 真範（産業技術総合研究所）

第32回熊谷記念真空科学論文賞（平成19年度）

「熱尖端流によって駆動される真空ポンプ内の希薄気流の数値解析」

杉元 宏（京都大学工学研究科航空宇宙工学専攻）

第32回真空技術賞（平成19年度）

「チタンの真空特性の研究と真空材料としての応用」

松浦 満, 栗巢普揮, 山本節夫, 木本 剛, 藤井寛朗,
田中和彦（山口大学工学部）

石澤克修, 野村 健, 村重信之（三愛プラント工業株式会社）

森本高志, 部坂正樹（新光産業株式会社）

宗山悦博, 竹田将利, 國重敦弘, 中川浜三, 白水啓太,
二井裕之（株式会社 UBE 科学分析センター）

第32回真空技術賞（平成19年度）

「大口径・長尺アルミナセラミックダクトの製作」

壁谷善三郎（三菱重工業株式会社）

金正倫計（原子力開発研究機構）

齊藤芳男（高エネルギー加速器研究機構）

萩原徳男（原子力開発研究機構）

第16回真空進歩賞（平成19年度）

「リアルタイム光電子分光観察を用いた表面研究」

小川修一（東北大学多元物質科学研究所）

第33回熊谷記念真空科学論文賞（平成20年度）

「ラジカル窒化シリコン酸窒化膜における窒素プロファイルの X 線光電子分光分析による評価」

河瀬和雅（三菱電機）・梅田浩司・井上真雄（ルネサステクノロジ）・諏訪智之・寺本章伸・服部健雄・大見忠弘（東北大学）

第33回真空技術賞（平成20年度）

「マイクロ/ナノイオンビームの生成技術」

成沢 忠（高知工科大学）, 根引拓也（高知工科大学）

第17回真空進歩賞（平成20年度）

「高速陽子の散乱を用いたイオン結晶表面の構造解析」

深澤優子（大阪教育大学教育学部）

第17回真空進歩賞（平成20年度）

「ネオン固体表面上からイオン衝撃脱離するクラスターイオンの観測」

立花隆行（立教大学先端科学計測研究センター）

第34回真空技術賞（平成21年度）

「硬質 BN 膜の切削工具への応用」

野間正男, 小松永治（神港精機株式会社）, 所 敏夫（滋賀県東北部工業技術センター）, 小川圭二, 中川平三郎（滋賀県立大学）

第35回熊谷記念真空科学論文賞（平成22年度）

「テーパー管の通過確率の近似式」

松田七美男（東京電機大学）

第35回真空技術賞（平成22年度）

「3次元立体アルミニウムマスクを用いたシリコン基板の反応性イオンエッチング加工技術の開発」

勝又信行, 石田正文（山梨県工業技術センター）

第35回真空技術賞（平成22年度）

「半導体デバイス解析用局所プラズマ加工装置の開発」

新堀俊一郎, 白山裕也, 川上辰男, 横須賀俊太郎, 樫村健太（株式会社三友製作所）, 綿谷 透, 清水哲夫, 内藤泰久, 徳本洋志（独立行政法人産業技術総合研究所）

第19回真空進歩賞（平成22年度）

「Pt 表面における分子反応の研究」

近藤剛弘（筑波大学）

第36回真空技術賞（平成23年度）

「小型高性能力覚センサを用いたロールツーロールパッタ装置用張力計測システム」

近藤真也, 玉置 肇（株式会社アサヒ電子研究所）, 小川倉一（小川創造技術研究所）

第36回真空技術賞（平成23年度）

「極高真空測定子（Bent Belt-Beam Gauge Head）の開発」

渡辺文夫（有限会社真空実験室）

第20回真空進歩賞（平成23年度）

「隔膜真空計を用いた圧力測定のための熱遷移補正」

吉田 肇（独立行政法人産業技術総合研究所）

第37回真空技術賞（平成24年度）

「環境制御型透過電子顕微鏡の開発とその応用」

矢口紀恵，長久保康平，松本弘昭，柿林博司（株式会社日立ハイテクノロジーズ），上野武夫（山梨大学燃料電池ナノ材料研究センター）

第21回真空進歩賞（平成24年度）

「Ag(111)表面上の水素分子のオルソ・パラ転換におけるファン・デル・ワールス力の影響」

國貞雄治（大阪大学大学院工学研究科）

第21回真空進歩賞（平成24年度）

「Formation of WO₃ Reduction Coloring Thin Film Using a Combination Sputtering Method Featuring Radio—Frequency Oxygen Plasma Irradiation」

野口大輔（都城工業高等専門学校物質工学科）

第1回真空会誌賞（平成24年度）

「物理的蒸着法による薄膜のナノ形態制御」

鈴木基史（京都大学大学院工学研究科）

第38回真空技術賞（平成25年度）

「活性酸素を利用した医療用滅菌器およびそのモニター開発」

吉野 潔，松本裕之，岩崎達行，木下 忍（岩崎電気株式会社），野田和俊（産業技術総合研究所），岩森暁（東

海大工学部）

第22回真空進歩賞（平成25年度）

「ルチルチタニア表面上の水の吸着及び解離に関する密度汎関数解析」

Susan Meñez ASPERA（大阪大学大学院工学研究科）

第2回真空会誌賞（平成25年度）

「真空・薄膜徒然草 1-20」

金原 粲（東京大学名誉教授）

第39回熊谷記念真空科学論文賞（平成26年度）

「真空容器の排気過程に関する新しい物理的描像の提唱」

杉本敏樹（京都大学大学院理学研究科），武安光太郎，福谷克之（東京大学生産技術研究所）

第39回真空技術賞（平成26年度）

「マイクロコイル真空計およびマイクロハクマク真空計の開発」

岡野夕紀子，田尻修一（株式会社岡野製作所），岡本昭夫（大阪府立産業技術総合研究所），小川倉一（小川創造技術研究所），美馬宏司（大阪市立大学）

第23回真空進歩賞（平成26年度）

「圧力—吸着状態密度変換式による水排気曲線の解析」

武安光太郎（東京大学生産技術研究所）

第3回真空会誌賞（平成26年度）

「表面分析の基礎(1)から(6)」

吉原一紘（オミクロンナノテクノロジージャパン株式会社）